$$np = n_i^2 \tag{1.10}$$

$$n_i^2 = N_c N_v e^{-(E_C - E_v)/kT} = N_c N_v e^{-Eg/kT}$$
 (1.11a)

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-(E_C - E_v)/2kT} = \sqrt{N_c N_v} e^{-Eg/2kT}$$
 (1.11b)

其中 E, 為式(1.1) 所定義的能隙。接下來,我們將針對以上所推導的式 子,作淮一步的重要說明:

(1)中於 N。與 N、的值相當接近(尤其是矽),所以(1.9)式的本質費米能 階 E: 相當接近能隙的中央(即 E。與 E, 的中間位置)如圖 1-1 中所顯示。 因此,在實際的應用上E.常被稱為能隙中心(midgap),即:

$$E_{i} \cong \frac{E_{c} + E_{v}}{2} \tag{1.12}$$

(2)公式(1.6)與(1.7)乃分別利用(1.3)與(1.5)得到的,因此不論對 本質半導體或對有摻雜雜質的半導體(稱為外質半導體,將於§1.1.5 節 中作深入介紹)來說都適用。只不過,對本質半導體而言, E_F可視為 與 E: 重疊, 因此(1.6)與(1.7)式亦可分別寫成:

$$n_i = N_c e^{-(E_C - E_i)/kT}$$
 (1.13)

$$n_i = N_v e^{-(E_i - E_v)/kT}$$
 (1.14)

以上兩式亦用到了本質半導體的基本定義(1.8)式。

(3)注意式(1.6) 與(1.7) 中 n 和 p 的乘積等於式(1.13) 與(1.14)的乘 ${\bf fh_i}^2$,此結果亦可由本質半導體的(1.8)式得到。因此,只要在熱平衡 狀態下,公式(1.10)對於本質半導體或是外質半導體都適用。此式說 明對一給定的半導體,在固定溫度下,半導體導電帶中的電子濃度n與 價電帶中的電洞濃度p的乘積永遠是一個固定常數。雖然這個方程式看 起來很簡單,但卻是半導體在熱平衡狀況的基礎原理,稱為質量作用定 律(mass-action law)。此公式須牢記在心!